

様式第十六（第11条第3項関係）

特定半導体生産施設整備等計画の概要

1. 認定の日付

令和6年2月6日

2. 特定半導体生産施設整備等計画認定番号

2023半経第002号-1

3. 認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称等

キオクシア株式会社（以下「キオクシア」）、キオクシア岩手株式会社（以下「キオクシア岩手」）、Flash Partners 有限会社（以下「FPL」）、Flash Alliance 有限会社（以下「FAL」）、Flash Forward 合同会社（以下「FFL」）

※FPL、FAL、FFLはキオクシアとウエスタンデジタルが出資する製造合弁会社。

※キオクシア岩手はキオクシアが100%の株式を所有。

4. 認定特定半導体生産施設整備等計画の概要

○ 特定半導体生産施設整備等計画の目標

- ・データセンター、医療や自動車など幅広いアプリケーションへの搭載が進み、市場が急拡大を続けるフラッシュメモリにつき、四日市工場及び北上工場にて、特定半導体である3次元フラッシュメモリ（第8世代製品）の生産能力を拡大させる。また、革新技術を導入した3次元フラッシュメモリ（第9世代製品）の生産基盤を四日市工場に構築し、特定半導体を継続的に生産していく。
- ・政府の支援措置を利用し、集中的な設備投資を行うことで、革新技術を伴う3次元フラッシュメモリ（第9世代製品）の開発・生産を前倒しする。
- ・四日市工場のみでなく、北上工場においても特定半導体の生産能力を強化することで、四日市に集中している生産を分散化し、災害に強いフラッシュメモリ生産・供給体制を実現していく。

○ 特定半導体生産施設整備の内容

● 施設概要（四日市工場）

- ・施設の所在地：三重県四日市市山之一色町800番地
- ・敷地面積：約69.4万㎡、建設面積：約26.9万㎡（四日市工場全体）
- ・主要製品：3次元フラッシュメモリ（第8世代製品及び第9世代製品）
- ・生産能力：6.0万枚/月（12インチ換算）
- ・総従業員数：約7,400名（継続生産開始時）

● 施設概要（北上工場）

- ・施設の所在地：岩手県北上市北工業団地6番6号
- ・敷地面積：約28.6万㎡、建設面積：約9.5万㎡（北上工場全体）
- ・主要製品：3次元フラッシュメモリ（第8世代製品）
- ・生産能力：2.5万枚/月（12インチ換算）
- ・総従業員数：約1,600名（継続生産開始時）

- 事業実施期間
 - <四日市工場>
 - (投資着手～操業開始) 2024年4月～2029年4月
 - <北上工場>
 - (投資着手～操業開始) 2023年1月～2027年4月

○ 特定半導体生産施設における生産の内容

- 施設で生産を行う半導体に関する内容
 - ・種類：記憶を行う半導体（積層された一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の層の数が百六十以上）
 - ・性能に関する説明：3次元フラッシュメモリの電子回路の積層数が218層以上

- 特定半導体生産施設整備等計画の下での事業実施期間

<四日市工場>

(初回出荷) 2025年9月

(継続生産) 2029年4月 ～10年以上の継続生産を予定

<北上工場>

(初回出荷) 2025年9月

(継続生産) 2027年4月 ～10年以上の継続生産を予定

- 製品の納入先に関する説明

メモ리카ードやスマートフォン、タブレット端末、パソコン/サーバー向けのSSDの他、データセンター、医療や自動車等分野

○ 指針適合性の確保

項目		確保措置の内容
安全性・信頼性	所有関係及びガバナンスの透明性の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・キオクシアホールディングス(株)、キオクシア、キオクシア岩手は監査役設置会社であり、取締役の職務執行を監査役によって監査するコーポレートガバナンス体制を構築。 ・FPL・FAL・FFLは、設備は所有するが、資産管理業務や製造に係る一切の業務はキオクシアまたはキオクシア岩手が業務委託/製造委託を受けて実施。
	外国の法的環境等による特定半導体生産施設整備等の適切性への影響	<ul style="list-style-type: none"> ・キオクシアの最終親会社であるBain Capital Investors LLCは米国法人だが、本事業の実施及び10年継続生産を制限するような米国の現行法はなく、法律改正も想定されていない。
供給安定性等	サプライチェーンを含む必要な生産能力確保に関する計画の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・キオクシア及びキオクシア岩手は、災害等の有事の際はサプライチェーン情報を元に早期の状況把握に努めている。 ・輸入に頼らざるを得ない原材料は輸入国の複数化や使用量削減等によりリスク分散を進めている。
	事業継続計画の策定	<ul style="list-style-type: none"> ・キオクシア及びキオクシア岩手は過去の半導体事故の調査等によるリスク事象の洗い出し、建物・設備など経営資源ごとに事業継続に係る方針・取組を策定するなどの対策を実施。

人材確保に関する取組	<ul style="list-style-type: none"> キオクシアグループでは、過去4年で約2,000名の新卒採用を実施している。 工場を有する東北や中部地区における産学官連携の取組のほか、業界やキオクシア独自の施策を実施。出前授業や講演会等を通し、小学校から大学まで幅広い層へアプローチし、人材育成に注力している。
その他国内の特定半導体の安定供給に資する取組	<ul style="list-style-type: none"> 本計画で、四日市工場のみでなく、北上工場の生産能力も拡大することで、日本における生産拠点の分散化を実現。各々の地域との連携を強め、引き続き安定した工場運営を行っていく。

- 特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の額及びその調達方法
 - 特定半導体生産施設整備を行うために必要な資金の額
約4,500億円
 - 整備した特定半導体生産施設における生産を行うために必要な資金の額
14年間で約2.1兆円の見込み
- 希望する支援措置
助成金交付
- 特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組に関する事項

項目	説明
需給がひっ迫した場合における増産に関する取組内容・体制の説明	<ul style="list-style-type: none"> キオクシア及びキオクシア岩手は、増加が見込まれるフラッシュメモリ需要に対応するため継続的に設備投資を行い、生産能力の強化を図る。 キオクシア及びキオクシア岩手は、日本政府から需給ひっ迫した際の対応の要請があった場合には、仕向け地の調整など真摯に協議に応じる。
特定半導体等の生産能力を強化するための投資に関する説明	<ul style="list-style-type: none"> 本計画で特定半導体の生産能力を増強するだけでなく、キオクシア単独でも年間数千億円レベルの設備投資を行い、国内生産能力を更に強化していく。
特定半導体等の生産能力を強化するための研究開発に関する説明	<ul style="list-style-type: none"> 設計面では更なる技術革新により工程短縮を図るとともに、加工面では装置メーカーとの共同開発により、高いコストパフォーマンスを実現している。 今後も継続的な積層数増や世界初技術の導入を行い、技術優位性を堅持することで、日本における生産能力を引き続き強化していく。
特定半導体等に係る技術上の情報を適切に管理するための体制に関する説明	<ul style="list-style-type: none"> キオクシア及びキオクシア岩手は、「情報セキュリティ管理規程」や「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」を整備済みであり、これに基づき、システム上のアクセス制限等を構築。 情報漏えいした際の処分（懲戒解雇、出勤停止、減給等）はリスクコンプライアンス委員会にて対応を決定。

(備考)

「4. 認定特定半導体生産施設整備等計画の概要」中、認定特定半導体生産施設整備等事業者の営業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載していない。